

要約書

第一の電極（１０２）にプラズマ処理が施される基体（１０１）を載置する。
基体（１０１）のプラズマ処理が施される面に対して磁場印加手段（１０３）に
5 より磁場を印加する。第一の電極（１０２）の外周囲に補助電極（１０４）を配
置し、その裏面（１０５）にプラズマを励起する。プラズマ中の電子を補助電極
（１０４）表面（１０６）から裏面（１０５）へ、且つ補助電極（１０４）の裏
面（１０５）から表面（１０６）へとドリフトさせる。

0327307.040601